

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
 【発行日】 平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)

【公開番号】 特開 2000-340628 (P2000-340628A)
 【公開日】 平成 12 年 12 月 8 日 (2000.12.8)
 【出願番号】 特願 平 11-153932
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/66
 G 0 1 R 1/06
 G 0 1 R 31/302
 H 0 1 J 37/147
 H 0 1 J 37/244
 H 0 1 J 37/28
 H 0 1 L 21/263

【F I】

H 0 1 L	21/66	S
G 0 1 R	1/06	F
H 0 1 J	37/147	B
H 0 1 J	37/244	
H 0 1 J	37/28	A
H 0 1 L	21/263	E
G 0 1 R	31/28	L

【手続補正書】

【提出日】 平成 17 年 7 月 11 日 (2005.7.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 発明の名称

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明の名称】 表面電位に基づく孤立パターン検出方法及びその電子顕微鏡

【手続補正 2】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 特許請求の範囲

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

試料表面に大電流電子ビームを浅い入射角度で照射し、試料表面各部位とアース間の電気伝導度の差に基づく電位差分布を発生させた該試料表面に、高分解能の観察用電子ビームを異なる方向から照射して二次電子顕微鏡画像を得、該画像に基づいて孤立パターンを検出する方法。

【請求項 2】

試料表面のある部分に一定時間大電流電子ビームを照射した後その部分に観察用電子ビームを照射して二次電子情報を検出する作業を実行し、続いて隣の部分に照射並びに検出作業の位置を順次シフトして行く走査によって観察領域の二次電子顕微鏡画像を得る請求項 1 に記載の孤立パターンを検出する方法。

【請求項 3】

試料ステージ上の試料に向けて電子ビームを照射する観察用電子ビーム照射鏡筒と二次

電子検出器と画像表示用のディスプレイからなる電子顕微鏡において、前記試料に対し、前記観察用電子ビーム照射鏡筒の電子ビームより浅い角度で電子ビームを照射する大電流電子ビーム照射鏡筒を別途配備し、両電子ビームの走査と両電子ビームの照射のON/OFFを互いに関連付けて制御することができる手段とを有する孤立パターン検出用電子顕微鏡。

【請求項 4】

二次電子検出器の前にエネルギーフィルターを配設し、該エネルギーフィルタには両ビーム走査と照射のON/OFFに関連付けて電圧が印加される請求項 3 に記載の孤立パターン検出用電子顕微鏡。